

SMIC detalla su proceso litográfico N+1, cercano a los 7 nm, para China

La Corporación Internacional de Fabricación de Semiconductores (SMIC) es la fundición de chips más avanzada de China y empezó a fabricar en masa a finales de 2019 con su proceso de 14 nm FinFET.

Pero está yendo bastante rápido en el desarrollo de sus litografías y ahora ha dado detalles del siguiente paso que va a dar con la tecnología que denomina N+1.

Ha querido dejar claro que no se trata exactamente de un proceso litográfico de 7 nm aunque sí es cercano, y aporta una sustancial mejora respecto al que tiene de 14 nm con la ventaja de que es más económico que el de 7 nm de otras compañías, en torno a un 10 %. Con este proceso se reduce hasta un 57 % el consumo, se mejora el rendimiento hasta un 20 % y se reduce el área de los chips hasta un 63 %.

Hoy en día la forma de medir los nanómetros de un proceso litográfico varía bastante de una empresa a otra porque no se corresponde al tamaño de un transistor sino a una aproximación en función de otros de sus características. De ahí que SMIC no haya querido darle una definición exacta en nanómetros, que por otro lado me parece adecuado.



Este proceso litográfico entrará en producción de prueba en el último trimestre de 2020 con la producción en masa comenzando en algún momento de 2021. Este es un paso más en la carrera del Hecho en China 2025, el plan por el que el país asiático quiere reducir su dependencia de países extranjeros en sectores clave, y el de la producción de chips es de los fundamentales hoy en día.

Fuente: AnandTech.